科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 26 年 5 月 25 日現在

機関番号: 13901 研究種目:挑戦的萌芽研究 研究期間: 2012~2013 課題番号: 24656381

研究課題名(和文)狭バンドギャップ強誘電体薄膜における光誘起電気物性発現メカニズムの解明

研究課題名(英文) Elucidation of mechanism on photo-induced electrical properties developing in narrow -bandgap ferroelectric material thin films

研究代表者

坂本 渉 (Sakamoto, Wataru)

名古屋大学・エコトピア科学研究所・准教授

研究者番号:50273264

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円、(間接経費) 930,000円

研究成果の概要(和文):狭バンドギャップ強誘電体薄膜を化学組成制御が容易な化学溶液プロセスにより作製し、可視光照射下での光誘起物性の解明を行った。光誘起電流の挙動から作製後の薄膜中での自己バイアス電界の存在を明らかにした。また、光誘起物性にはバンドギャップと強誘電特性が大きく影響し、抗電界以上の電界で分極処理することにより光電流および光起電力を分極方位に反転可能なことがわかった。さらなる特性向上のためには、貴金属微粒子との複合化が効果的であった。

研究成果の概要(英文): Fabrication of narrow bandgap ferroelectric thin films was carried out by the chem ical solution deposition process that chemical composition control was facile, and the elucidation of phot o-induced electrical properties under the visible light irradiation was performed. The existence of the se If-bias electric field in the film after the preparation was clarified by the behavior of the photo-induced electric current. In addition, photo-induced electrical properties were greatly influenced by bandgap and ferroelectric properties, the polarization direction could turn over the photo-induced current and photo voltage by poling treatment with applying an electric field more than a coercive field. For the further properties improvement, it was effective to prepare the composites with noble metal nanoparticles.

研究分野: 無機材料科学

科研費の分科・細目: 工学・無機材料物性

キーワード: 強誘電特性 バンドギャップ 光誘起電流 光起電力 薄膜作製

1.研究開始当初の背景

今日の各種センサ技術の進化に加えて、低消費電力の電子回路が開発されたことが原因となり、運動・光・熱エネルギーといった環境エネルギーを電力に変換する「エネルギーハーベスティング」技術(太陽電池などもこの中に含まれる)は大変注目され、この技術を用いた「永久に動作する装置」に関する研究開発が国内外で精力的に行われるようになった。

2. 研究の目的

本研究では、新しいタイプのエネルギーデバイス誕生の可能性を秘めた可視光領域の波長の光を吸収する狭バンドギャップペロブスカイト型強誘電体酸化物(BiFeO₃)を中心とした薄膜材料に関して、以下の内容を研究目的とした。

- (1) 光起電力 (光電流)機能を効率よく発現 させるための化学組成、結晶構造と欠陥 構造の制御を目指す。
- (2) 望む物性発現の鍵を握る構成元素に関する局所構造(主に電子構造)解析と微構造評価、強誘電ドメイン構造に対応させた光誘起電流挙動の解析をもとに、光学的特性と電気的特性間の関係(特に、光と強誘電分極状態の相互作用)の解明および光応答特性の向上を達成する。
- (3) 本材料系薄膜の将来のエネルギーデバイス応用に向けた基礎的な探索を行う。

次世代薄膜型集積エネルギーデバイス実現への道を拓くことを念頭に置いて本研究の遂行を目指す。

3.研究の方法

本研究では、以下に示すような検討を行うことにより、 $BiFeO_3$ 系酸化物強誘電体薄膜を将来のエネルギーデバイスへ応用するためのアプローチを行う。

(1) 光誘起電流を利用した環境発電デバイス としての応用に必要な特性を発現する狭 バンドギャップ BiFeO3 系材料設計および 環境に優しい溶液を用いる化学的方法に よる薄膜作製条件の最適化を行う。

- (2) 作製した薄膜試料の光学的特性と強誘電ドメイン構造(分極状態) さらには結晶構造中の各構成元素(特に、機能発現の鍵を握る構成元素)の状態と格子中の欠陥構造などを正確に解析し、本研究で扱う材料薄膜の特徴的な光学的機能(光学がンドギャップなど光学的特性とが表しているでででいたが、光学が、といるでは、エネルギー)の光照射をでいる電気的特性との間に働く関係(相互作用)の解明による制御因子と特性向上のための方策の提案・実証を行う。
- (3) 実際のエネルギーデバイス応用の可能性 探索を達成することを目標とし、エネル ギーハーベスター素子への応用へ向けた 問題点の抽出と解決策の提案も行う。

4. 研究成果

目的化合物薄膜を得るための適切な出発金属-有機化合物原料の選択および溶液反応の制御により、均一かつ安定な薄膜作製用前駆体溶液の調製を可能とした。また、前駆体薄膜の加熱処理条件の最適化を行い、ペニで、揮発性の主成分元素である Bi の化を Bi FeO3(BF)薄成に関しては、作製した Bi FeO3(BF)薄成に関しては、作製した Bi 過剰組成を調整することで、対した Bi 過剰組成を調整することで、おける Bi 過剰組成を調整することで、は料の絶縁性を制御しつつ最適値を決定した。この過剰 Bi 成分により加熱処理時の Bi の過剰 Bi 成分により加熱処理時の Bi の過剰 Cを補償し、薄膜中の欠陥量を減少させることができたと考えられる。

一方、作製した BF 薄膜の光学的特性につ いては、幅広い波長領域で光透過性の高い MgO(100)基板上に作製した薄膜に対して紫 外・可視光分光光度計による光透過特性を評 価した。BF 薄膜は可視光域の光を吸収し、算 出されたバンドギャップの値は約 2.1 eV と なり、これは BF を間接遷移型半導体として 見積もった報告値に近い値であることがわ かった。本研究では、BF 薄膜の光誘起電流挙 動について調べるために 100 ₩ のキセノンラ ンプを用いた可視光(400-700 nm) 照射 on-off 状態での薄膜上部・下部電極間を短絡 したときに流れる電流値(ゼロバイアス電界 下)を測定した。この測定により図 1 に示す ような光照射時に誘起される電流が再現性 よく検出できた。さらに、照射光の波長によ る影響を調べるために、青色光(450 nm)、緑 色光(530 nm)、赤色光(650 nm)など異なる波 長の光を用いて同様の測定を行った。その結 果、照射光の波長が短くなるにつれて光電流 の値は増加した。このことは、照射光のエネ ルギーが大きいほど光励起される電子のエ ネルギーが増加し、BF 薄膜のバンドギャップ を超えやすくなるためであると考えられる。 また、図2に示されるような電流-電圧特性 における青色光照射の有無による違いから 光起電力 (開回路電圧)を求めたところ、約 0.36 V であることがわかった。

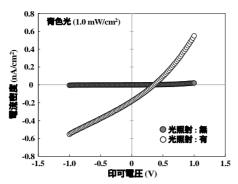


図2 BiFeO₃薄膜の電流密度 - 印可電圧曲線 における青色光照射の有無による違い

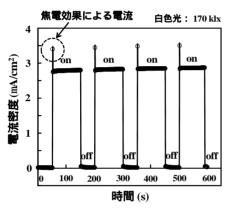


図1 光照射の有無によるBiFeO3薄膜からの ゼロバイアス下での光電流密度

ここでは、分極処理操作を行っていない多結晶薄膜で光電流が検出された。BiFeO3系薄膜の可視光照射下での光誘起特性には、バロマップの値の他に作製後の薄膜中にしてでする自己バイアス電界が大きく関係していること、かつその大きさと方向について電条件・可視光照射条件下での薄膜の電流・電圧特性をもとに約0.2・0.4 Vの内部バイ電スが存在していることを明らかにした。また、ここでの自己バイアス電界は、薄膜中の欠損に大変での自己がイアスである。第1の欠損に分布)が主たる発生原因であることが考えられる。

強誘電体化合物における光誘起電流や光 起電力に関しては、分極処理(分極方向をそ ろえること)が重要である。BF 薄膜は強誘電 体として抗電界が非常に大きいために室温 域での分極処理は困難であることから、ペロ ブスカイト PbTiO3 強誘電体酸化物との固溶 体化を検討した。BiFeO₃-PbTiO₃ (BF-PT)系薄 膜とすることにより、図3に示すように強誘 電体としての特性を維持しつつ抗電界を減 少させることに成功し、ここで作製した BF-PT 薄膜から分極方位による光電流の方位 制御が可能であることが見いだされた(図4 を参照)。BiFeO。系薄膜の分極状態の解析と光 誘起特性との関係については、走査型プロー ブ顕微鏡を応用して外部バイアス電界を変 化させたときの微少電流像と表面電位像の

撮像に成功し、その変化の挙動を可視化する ことができた。

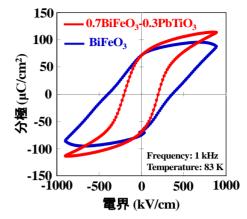


図3 低温で測定したBiFeO₃および0.7BiFeO₃-0.3PbTiO₃薄膜の分極 - 電界特性

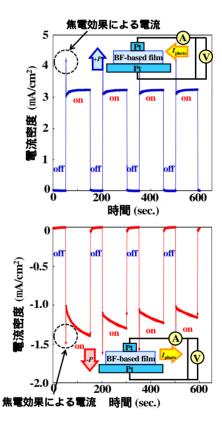


図4 分極方位により反転する0.7BiFeO₃-0.3PbTiO₃ 薄膜の光電流挙動

本研究では BF 薄膜への他元素のドープ(10 mol%以下)効果についても検討した。特に Fe サイトへ Mn あるいは Bi サイトへ La をドープした薄膜においてペロブスカイト単相への結晶化かつ電気的特性の改善が見られた。Mn ドープ BF 薄膜では Mn のドープ量増加に伴い光電流値(+光起電力値)が減少した。これは図5に示されるような薄膜中のキャリアをトラップして低減させる Mn (多価イオン)のアクセプター効果によるもの(+電極-薄膜界面の効果)と考えられる。薄膜中の金属陽イオンの価数が影響を及ぼす欠陥構造と

各特性との関係は、光電子分光分析により特に構成元素中の Fe イオンの価数について解析を行い、その価数変化(Fe³+と Fe²+)の挙動をもとに薄膜の電気絶縁特性と光誘起電流特性との関係を明らかにした。また、La ドープ BF 薄膜においても光電流はわて BF 満に減少した。これは La のドープによっての BF 結晶格子歪みが緩和され、化合物としての強誘電性がわずかに低下したためと考えら BF 系薄膜についてバンドギャップの値を算出したところ、いずれの薄膜も約 2.2 eV となりドープ無しの BF 薄膜と比較して大きな違いは見られなかった。

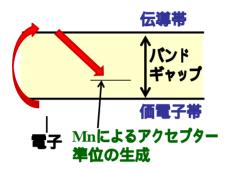


図5 BiFeO3中の価電子帯から伝導帯に 光励起された電子とMnドープにより 生成したエネルギー準位との関係

さらに、BF 薄膜の光誘起される特性の向上 を目指し、他元素ドープに対して Ag ナノ粒 子の複合化に関する検討を行った。その結果、 図6に示されるようにAgナノ粒子/BF薄膜に おいて BF 薄膜よりも大きな光電流が検出さ れた。ここでの光電流値は Ag ナノ粒子を複 合化していない BF 薄膜の 6 倍以上の値であ った。これは BF 薄膜中に導入された Ag ナノ 粒子の表面プラズモン効果によるものと考 えられ、光電流の増強に対する顕著な効果が 見いだされた。Agナノ粒子の表面プラズモン 効果の強度は、Ag ナノ粒子の粒径、粒子サイ ズ分布、粒子の形状、表面の酸化状態、BF と の反応相などの影響を受けるため、これらの 条件を精密に制御して BF 薄膜中に導入する ことで、BF の光誘起特性のさらなる向上が期 待できる。

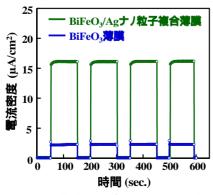


図6 BiFeO₃薄膜およびBiFeO₃/Agナノ粒子 複合薄膜の光電流挙動

また、作製した薄膜のデバイス応用に向け た可能性探索については、BiFeO。系薄膜が発 生する光電流・光起電力は長時間(数時間) にわたって安定なこと、薄膜の微細加工には 通常の半導体プロセスが適応可能なことを 明らかにした。エネルギー(ハーベスティン グ)素子などBiFeO。系薄膜のデバイス化を考 えた場合、光照射下での応答速度については 十分なものの、エネルギー密度が未だ低いた め、ここで見いだされた貴金属ナノ粒子の複 合化、薄膜中の欠陥濃度分布制御などによる 改善の他に、結晶成長の方位を制御したエピ タキシャル薄膜の作製による強誘電ドメイ ン構造制御、透明導電性酸化物との複合化な ど新規な複合構造の形成が今後の課題であ ることがわかった。

5. 主な発表論文等

[雑誌論文](計 1 件)

N. Makino, <u>W. Sakamoto</u>, K. Yoshida, M. Moriya, <u>T. Yogo</u>, "Photocurrent Properties of BiFeO₃ Thin Films Prepared by Chemical Solution Deposition", Ferroelectrics, 查読有, vol.453, pp.20-25 (2013). DOI: 10.1080/00150193.2013.842086

[学会発表](計 11 件)

- 1. 片山 丈嗣,守谷 誠,坂本 渉,余語 利信,「化学溶液法によって合成したBiFeO₃/ITO 積層薄膜の光誘起電気特性」,第 23 回日本 MRS 年次大会,2013 年 12 月9日,横浜情報文化センター(横浜市)
- 2. 吉田 健司,守谷 誠,<u>坂本 渉</u>,<u>余語 利</u> <u>信</u>,「化学溶液法により調製した Mn ドー プ BiFeO。薄膜の光電流特性」,第 23 回 日本 MRS 年次大会 2013 年 12 月 9 日,横 浜情報文化センター(横浜市)
- 3. 吉田 健司,守谷 誠,<u>坂本 渉,余語 利</u> 信,「他元素ドープが BiFeO₃ 薄膜の電気 的・光学的特性に及ぼす影響」,平成 25 年度日本セラミックス協会東海支部学術 研究発表会,2013 年 12 月 7 日,名城大 学(名古屋市)
- 4. 片山 丈嗣, 守谷 誠, <u>坂本 渉</u>, <u>余語 利</u> 信,「化学溶液法による BiFeO₃/透明導電 性酸化物積層薄膜の合成と評価」,日本セ ラミックス協会第 26 回秋季シンポジウム,2013年9月4日,信州大学(長野市)
- 5. 吉田 健司,守谷 誠,<u>坂本 渉</u>,余<u>語 利信</u>,「Mn ドープ Bi FeO₃ 薄膜の電気的・光学的特」,日本セラミックス協会第 46 回東海若手セラミスト懇話会 2013 年夏期セミナー,2013 年 6 月 20 日,ホテル犬山館(犬山市)
- W. Sakamoto, N. Makino, K. Yoshida, M. Moriya and <u>T. Yogo</u>, "Synthesis and Photo-Induced Electrical Properties of Bismuth Ferrite-Based Thin Films", The 10th Pacific Rim Conference on

Ceramic and Glass Technology (PacRim10-2013), June 4 (2013), San Diego (U.S.A.)

- 7. 牧野 成道, 守谷 誠, <u>坂本 渉, 余語 利</u> <u>信</u>, 「BiFeO₃ 系薄膜における電気的および 光学的特性」, 第 51 回セラミックス基礎 科学討論会, 2013 年 1 月 9 日, 仙台国際 センター(仙台市)
- W. Sakamoto, K. Yoshida, N. Makino, M. Moriya, T. Yogo, "Electrical and Optical Properties of Mn-doped BiFeO₃ Thin Films Synthesized by Chemical Solution Deposition", The 8th Asian Meeting on Ferroelectrics (AMF-8), December 11 (2012), Pattaya (Thailand)
- 9. 吉田 健司,守谷 誠,<u>坂本 渉</u>,<u>余語 利</u> <u>信</u>,「化学溶液法による Bi (Fe,Mn)0。薄 膜の作製と電気的・光学的特性」,日本セ ラミックス協会第 25 回秋季シンポジウム,2012 年 9 月 19 日,名古屋大学(名 古屋市)
- 10. <u>坂本 渉</u>,「マルチフェロイック酸化物の 材料設計と強磁性強誘電体薄膜作製への アプローチ」,日本セラミックス協会 東 海支部 第 44 回東海若手セラミスト懇話 会 2012 年夏期セミナー,2012 年 6 月 28 日,ウェルシーズン浜名湖(浜松市)
- 11. <u>坂本 渉</u>,「機能性酸化物材料のケミカル プロセスによる合成と特性評価 - 強誘 電体薄膜を中心に - 」, 平成 24 年度応用 物理学会北陸・信越支部講演会, 2012 年 6月6日,金沢大学(金沢市)

6.研究組織

(1)研究代表者

坂本 涉(SAKAMOTO, Wataru)

名古屋大学・エコトピア科学研究所・准教 授

研究者番号:5027326

(3)連携研究者

余語 利信 (YOGO, Toshinobu)

名古屋大学・エコトピア科学研究所・教授

研究者番号:00135310